

電子ビーム描画装置、EUV 露光装置、ナノインクプリントリソグラフィー向け

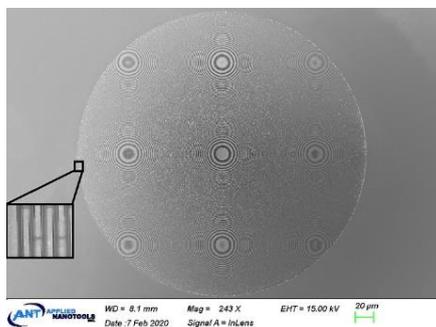
H-SiO_x 粉体のレジスト

粉体のレジストならではの特徴：

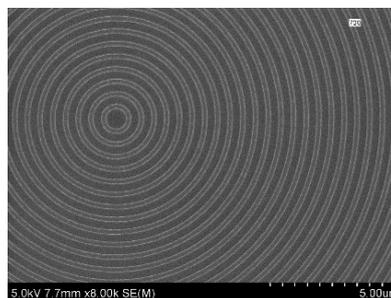
- 長期間の保管が可能です …1年間の保管期間
- いつも同じ粘度で使えます …使用前に溶媒と混合して使うので増粘しません
- 広い範囲の厚さの膜を作れます …粘度を調整する事ができます
- 5nmの膜厚、<10nmの解像度 …最新のテストで達成しました
- 廃棄する量を減らせます …長期保存ができ、少量単位で購入出来ます
- しっかりしたサポート体制 …経験豊富な AQM 社がサポート
- 優れた LER(Line Edge Roughness)
- 強いドライエッチングに対する耐性



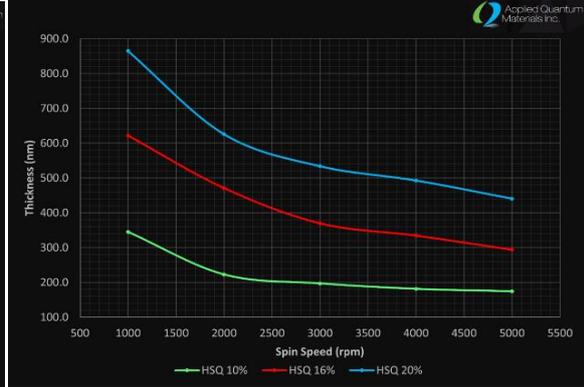
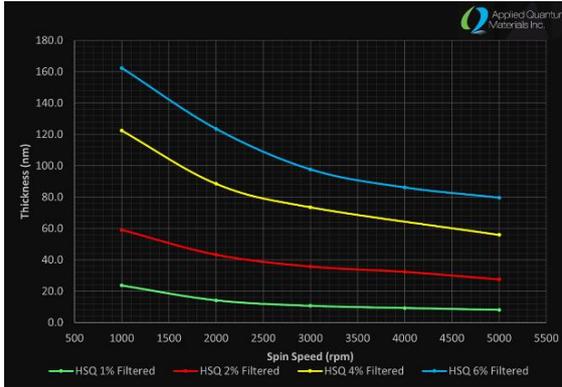
粉体の H-SiO_x



H-SiO_x のパターン画像 1



H-SiO_x のパターン画像 2

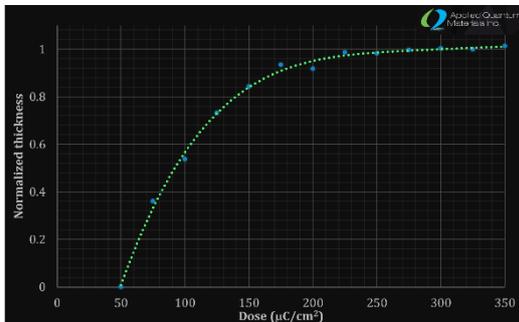


MIBK 溶媒中 1, 2, 4 and 6% H-SiO_x のスピナーカーブ

MIBK 溶媒中 10, 16 and 20% H-SiO_x のスピナーカーブ

H-SiO _x	MIBK	w/w 溶液
1.002 g	5.0mL	20%
0.256 g	5.0mL	6%
1.024 g	20.0mL	6%
0.0405 g	5.0mL	1%

各濃度の H-SiO_x と MIBK の重量



90 秒間 MF-319 で現像された 80nm H-SiO_x のコントラストカーブ

より詳細なカタログは [こちら](#)

MIBK 溶媒との混合マニュアルは [こちら](#)

エリオクス株式会社による EB 描画装置を用いた評価結果は [こちら](#)

H-SiO_x (粉体) の SDS は [こちら](#)

H-SiO_x (粉体+MIBK 溶媒) の SDS は [こちら](#)